

研究開発用途向け 小型真空装置

研究開発用途に最適な、小型卓上の真空装置を各種ラインナップ。
大気非暴露機構にも多種対応いたしております。

大気非暴露型試料搬送機構カスタマイズ例をご紹介します。
電池材料や電極作成に。大気に触れることなく成膜プロセスを完遂させます。

スパッタ装置 MSP-20TK 形

空冷式マグネトロン電極により冷却水が不要です。
煩雑な操作を必要としないシンプルな操作性。
タングステンをはじめとした多種金属にも対応。

- 貴金属 (Pt、Pt-Pd、Au、Au-Pd、Ag)
- 金属材料 (W、Mo、Ti、Ta、Cr、etc..)



真空蒸着装置 VE-2030 形

シンプルな排気系と無駄のない操作性。
様々なニーズに対応可能な豊富な拡張性。

- カーボン蒸着 (替え芯型カーボン使用)
- 金属蒸着 (Au、Cr、Al、Cu、In、etc..)
- 有機材料蒸着にも最適



小型でシンプルな装置は、大掛かりな装置に比べて研究のパートナーに最適です。
圧倒的な低コストでスピーディーな研究開発をサポートいたします。

株式会社真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町1285-5

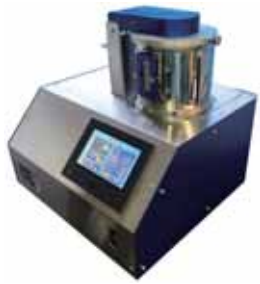
電話：029-212-7600

ホームページ：<https://www.shinkuu.co.jp/>





TEM・SEM用の試料前処理装置の他、 特別注文での真空装置も製造販売。



MSP-40T 形

全自動スパッタリング【マグネトロンスパッタ装置】

多目的、実験用塗膜・電子顕微鏡用導電膜に利用可能です。
水冷式強磁場ターゲット電極を採用。
プログラム制御により完全自動化された高性能モデル。
レシピ登録機能搭載で研究開発をサポート。
Cr、Mo、Ti、C、Ge、Si、ITOなどの成膜が可能。
ターボモレキュラーポンプ+ダイヤフラムポンプで清浄真空。



TVS-40T 形

4本の独立した排気チャンバーを搭載【TEMホルダー保管装置】

TEMホルダーを真空下で保管する装置です。
独立した真空室に保管するため、個別に出し入れが可能です。
プログラム制御による自動排気やインターロック制御を搭載。
タッチパネル搭載で直感的に操作が行えます。
TEMホルダーポートはお客様のご使用になられている
TEMホルダーに合わせて製作する事が可能です。
高真空保管する事によりコンタミネーションの発生を大幅に軽減。



HPC-20 形

超精密アモルファス金属成膜【オスミウムコーター】

φ100mm 大面積試料ステージを採用。
成膜操作を完全自動化。誰でも簡単に成膜が可能です。
ホローカソード電極採用で低温・低電圧・低ダメージ設計。
高さの違うサンプルも、複数サンプルも同時にコーティング可能。
排出口には専用オスミウム・トラップ付属、
高密度活性炭フィルターで四酸化オスミウムの大気拡散を遮断。
密閉空間でオスミウムアンブルを割断する機構を標準搭載。



PIB-20 形

親水処理からPDMS貼合せまで【プラズマイオンボンバーダ】

φ130mm 大面積試料ステージを採用。
雰囲気ガス導入・圧力調整機能付きで、あらゆる分野の研究に。
電子顕微鏡支持膜の親水化、油脂・有機材料などのエッチング、
PDMSの貼り合わせにも応用可能です。
オートスタートスイッチでプラズマ照射プロセスを完全自動化。



VES-10 形

電子顕微鏡向け前処理機能複合機【マルチ成膜装置】

弊社で実績のあるVC-100S・MSP-1S・PIB-10の機能を統合。
用途別にチャンバーを2系統持っています。
カーボン蒸着はTEM支持膜の補強やX線分析に使用。
スパッタはSEM試料を低ダメージで導電処理。
親水処理は支持膜やダイヤモンドナイフの親水化に使用。
自動プログラムによるフルオート機能やインターロックが充実。
オプションでカーボン電極追加、ブレーカー類の追加が可能です。

この他にも多数ラインナップを揃えております。デモのご依頼は弊社ホームページからも受付中。